



Patent dodatkowy
do patentu nr _____

Zgłoszono: 23.02.78 (P. 204850)

Pierwszeństwo: _____

Zgłoszenie ogłoszono: 11.09.78

Opis patentowy opublikowano: 15.10.1981

Int. Cl.²

B04B 15/06

CZYTELNICIA

Urzedu Patentowego

Twórcy wynalazku: Dariusz Dziadkiewicz, Romuald Sulima

Uprawniony z patentu: Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Polska)

Sposób usuwania osadu ze zbiorników, zwłaszcza wirówek sedymentacyjnych

1

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania osadu ze zbiorników, zwłaszcza wirówek sedymentacyjnych. W szeregu procesów technologicznych występuje zjawisko osadzania osadów na ściankach zbiorników, na przykład w zbiornikach sedymentacyjnych, do których między innymi należą wirówki sedymentacyjne.

Dotychczas w celu usuwania osadów ze ścianek zbiorników stosuje się sposób mechanicznego ich usuwania jak również sposoby chemiczne polegające na działaniu substancjami rozpuszczającymi osady. Według wynalazku, przed napełnieniem zbiornika jego ścianki pokrywa się nośną warstwą łatwotopliwej substancji chemicznie obojętnej dla zamierzonego procesu o temperaturze topnienia wyższej od temperatury tego procesu, korzystnie warstwą parafiny. Po zakończeniu procesu usuwa się roztwór ze zbiornika a następnie warstwę nośną poddaje się stopnieniu i usuwa się ją wraz z osadem ze zbiornika. Sposób według wynalazku cechuje prostota i walory ekonomiczne gdyż zostają wyeliminowane pracochłonne czynności stosowanie narzędzi do czyszczenia zbiorników lub środków chemicznych.

2

Przykład wykonania wynalazku. Ścianki wewnętrzne wirówki sedymentacyjnej pokrywa się stopioną parafiną. Po zastygnięciu parafiny w wirówce przeprowadza się proces sedymentacji, podczas którego na warstwie parafiny odkłada się osad. Po zakończeniu procesu sedymentacji doprowadza się roztwór z wirówki a następnie stapia się warstwę parafiny którą usuwa się wraz z osadem.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób usuwania osadu ze zbiorników, zwłaszcza wirówek sedymentacyjnych, **znamienny tym**, że przed napełnieniem zbiornika jego ścianki pokrywa się nośną warstwą łatwotopliwej substancji chemicznie obojętnej dla zamierzonego procesu o temperaturze topnienia wyższej od temperatury tego procesu, korzystnie warstwą parafiny i po zakończeniu procesu usuwa się roztwór ze zbiornika a następnie warstwę nośną poddaje się stopnieniu i usuwa się ją wraz z osadem ze zbiornika.